PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-238083

(43)Date of publication of application: 22.09.1989

(51)Int.CI.

H01S 3/133

(21)Application number : 63-063537

(71)Applicant: NKK CORP

(22)Date of filing:

18.03.1988

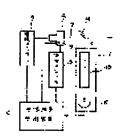
(72)Inventor: MATOBA YUJI

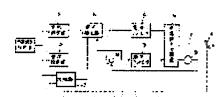
KOMATSU YOSHIHIKO

(54) OSCILLATION WAVELENGTH STABILIZATION OF SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To control oscillation wavelength accurately, by detecting the temperature of a semiconductor laser element and then, obtaining the difference between the above detected temperature and the temperature that is set in advance. thereby correcting that of the semiconductor laser element by causing a current value that is set in advance to vary. CONSTITUTION: Once the temperature of a semiconductor laser device 6 varies, the oscillation wavelengths of a laser beam 7 deviate from the set values 1 of the oscillation wavelengths and then, a temperature controller 5 performs movements to correct the temperature of the semiconductor laser device 6. Because of a capacitance of the semiconductor laser device 6, the above temperature control increases system time constant and lengthen the time of a transient state. During this transient time, a light detecting signal outputs wavelength deviation detecting signals from a comparator 17 to the effect that the oscillation wavelengths of the laser beam 7 deviate from the set value 1 of the oscillation wavelength and the above signals are sent to a current corrector 18 of an





oscillation wavelength control device 10. The current corrector 18 takes the difference between the temperature set value 3 that is obtained by a subtracter 8 and the temperature of the semiconductor laser device 6 that is detected by a temperature detector 9 and corrects the current set value 2. Then the corrected current value is transmitted to a current controller 4.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-238083

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)9月22日

H 01 S 3/133

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称 半導体レーザの発振波長安定方法

> ②特 顧 昭63-63537

220出 昭63(1988) 3月18日

700発明 的場

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

内

四発 明 者 小 松 彦

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

勿出 願 人 日本鋼管株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 佐々木 宗治

外1名

1. 発明の名称

半導体レーザの発振波長安定方法

2. 特許請求の範囲

半導体案子の温度と投入電流を各々一定値に保 つことにより半導体レーザの発振波長を安定させ る方法において、

半導体素子の温度を検出し、あらかじめ設定し た温度と検出した温度との差を求め、求めた温度 差によりあらかじめ設定した電流値を変化させ半 導体素子の温度による波長のずれを補正すること を特徴とする半導体レーザの発振波長安定方法。 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は半導体レーザの発振波長を精度良く 安定させる発振波長安定方法に関する。

[従来の技術]

半導体レーザを利用した計測方法として例えば 半導体レーザを気体に照射して気体の吸収能を測 定することにより、気体の濃度等を検出する方法 が 開示されている (雑誌センサ技術第29頁~第31 頁1988年2月号)。

この計測方法は気体分子の吸収係数がレーザ光 の波長により異なることを利用したものである。 一方、半導体レーザの発振モードは投入電流によ って変化し一般に多数存在する。それらの発援ス ペクトル幅は0.01~0.2ng 程度である。この半導 体レーザを上記計測方法に利用する場合は半導体 レーザの発援波長が気体の吸収波長に合うように 制御する必要がある。

第4図は従来の半導体レーザの発振波長を一定 にするための制御方法を示すプロック図である。 第4図に示すように半導体レーザの発振波長の設 定値1に応じて電流設定値2と温度設定値3を定 め、この電流設定値2と温度設定値3になるよう に電流コントローラ4と温度コントローラ5で半 導体レーザ装置 6 の投入電流と温度をそれぞれ独 立に制御して、半導体レーザ装置6から出射する レーザ光7の発援波長を一定にしている。なお、 第4図において8は温度検出器9で検出した半導

体レーザ装置 6 の温度と温度設定値 3 との差を求める減算器である。

[発明が解決しようとする課題]

半導体レーザの発援波長に対する電流と温度の 関係は、例えば第5図の電流と発振波長の特性図 及び第6図の温度と発振波長の特性図に示すよう に、電流変化が発振波長の変動に影響するよりも、 温度変化が発振波長の変動に影響するよりも、 きい。また、第4図に示した電流と温度の制御に おいては、温度制御の整定時間は一般に電流制御 の整定時間に比べると長くなる。

したがって、外乱を受けて半導体レーザ装置 6 の温度が変化したときの温度制御の過渡時には半導体レーザの発援波長がずれて、発振波長が例えば気体の吸収帯から外れてしまい、かつ発振波長を設定値にするのに時間を要するという問題点があった。

この発明はかかる問題点を解決するためになされたものであり、温度制御の過渡時においても半 導体レーザの発振波長を精度良く制御することが

[実施例]

第1図はこの発明の一実施例に係る制御装置の構成図である。第1図において、10は発振波長制御装置であり、この発振波長制御装置10は半導体レーザ装置6に投入する電流と半導体レーザ装置6の温度とを設定し、設定した電流値と温度をそれぞれ電流コントローラ4と温度コントローラ5に送り出す。

半導体レーザ装置 6 は第2 図に示すように半導体素子11と例えばサーミスタからなる温度検出器9 とを例えば銅ブロック 12に固定し、この銅 プロック 12の温度を例えばベルチエ素子からなるの発熱 装置 13により可変できるように構成されている。14はレーザ光7の一部を反射する半透明平面鏡であり、半透明平面鏡で反射したレーザ光7 はガスセル 15を通して光検出器 16に送られる。ガスセル15には発振波長と合った吸収波長を有する気体が封入されており、このガスセル15と光検出器16により

できる半導体レーザの発振波長安定方法を得ることを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

この発明に係る半導体レーザの発振波長安定方法は半導体レーザ装置の半導体レーザ素子の温度と観波長を安定させる方法において、半導体レーザ線子の温度を検出し、検出した温度とあらかじめ設定した電流値を変化させ半導体レーザ楽子の温度を補正することを特徴とする。

[作用]

この発明においては、半導体レーザの発振波長
が温度変化より投入電流の変化によってはあまり
大きく影響されないことを利用し、温度変化の過
波時における半導体レーザ素子の温度を電流制御
系に取り込み、半導体レーザ素子の温度を補正す
るような電流を半導体レーザ素子の温度を変化さ
電流によっても半導体レーザ素子の温度を変化させる。

光導体レーザ装置6から出射するレーザ光7の発振波長と発振波長制御装置10で設定した設定発振波長制御装置10で設定した設定発振波長の比較器17を構成している。

上記のように構成した制御装置により半導体レーザの発振波長を一定値に制御する場合の動作を第3図に示した制御プロック図に基いて説明する。

この状態で温度の外乱を受けて半導体レーザ装 置6の温度が変化すると、半導体レーザ装置6か ら出射するレーザ光7の発振波長が発振波長設定 値1からずれてしまう。このとき温度コントロー ラ 5 は半導体レーザ装置 6 の温度を補正する動き を行なう。しかし、この温度制御は半導体レーザ 装置6の銅プロック12等の容量があるため系の時 定数が大きく過渡状態の時間が長くなる。この過 渡時間の間比較器17からは光検出信号としてレー ザ光フの発掘波長が発掘波長設定値1からずれた という波長ずれ検出信号を出力して発振波長制御 装置10の電流補正器18に送る。電流補正器18は波 長ずれ検出信号を受けとると、減算器8で求めた 温度設定値3と温度検出器9で検出した半導体レ 一ザ装置6の温度との差を取り込み、半導体レー ザ装置6の過波状態の温度を補正するように電流 設定値2を補正し、補正した電流値を電流コント ローラ4に送る。電流コントローラ4は半導体素 子11の投入電流が補正した電流値になるように制 御する。この電流制御の系の時定数は温度制御系 の時定数よりも小さいため、半導体レーザ装置 6 から出射するレーザ光 7 の発 援 波 長 のずれを 温度制御系のみで補正するよりも電流制御系をも用いて制御することにより早く補正することができる。したがって温度の外乱により生じた過波状態の時間を短かくすることができ、レーザ光 7 の発援被長をいち速く定常状態とすることができる。

レーザ光7の発振波長が定常状態になると、比較器17から出力される光検出信号はもとの安定状態に復帰し、電流補正器18の電流補正動作は停止し、電流コントローラ4には電流設定値2が送られ電流制御系と温度制御系は安定する。

[発明の効果]

この発明は以上説明したように、温度制御の過波時に生じる半導体レーザの発掘被長のずれを電流制御系にも帰還し、発振被長のずれを電流制御系でも補正するようにしたので、発振波長のずれを速く補正することができる。したがって半導体レーザの発振波長を精度よく制御することができ、波長が安定したレーザ光源を得ることができる効

果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の実施例に係る制御装置を示す構成図、第2 図は上記実施例の半導体レーザ装置を示す側面図、第3 図は上記実施例の制御プロック図、第5 図は電流と発振波長の特性図、第6 図は温度と発振波長の特性図である。

1 … 発振波長段定値、 2 … 電流設定値、 3 … 温度投定値、 4 … 電流コントローラ、 5 … 温度コントローラ、 6 … 半導体レーザ装置、 7 … レーザ光、 8 … 減算器、 9 … 温度検出器、 10 … 発振波長制御装置、 11 … 半導体レーザ素子、 15 … ガスセル、 16 … 光検出器、 17 … 比較器、 18 … 電流補正器。

代理人 弁理士 佐々木宗治

第一図

